

請求の範囲

- [請求項1] 処理液を貯留するとともに、複数の基板を起立した状態で所定のピッチで配列させて収容する処理槽と、
- 前記複数の基板の配列方向に延設された管状の第1吐出部とこの第1吐出部と同軸にされ前記配列方向に延設された管状の第2吐出部とに、前記複数の基板が配列する配列範囲内で区分され、前記第1吐出部及び前記第2吐出部の区分された側の一端が閉塞されるとともに、前記第1吐出部及び前記第2吐出部に前記配列方向に沿って複数のガス吐出孔が形成された複数の気泡管部を有し、前記処理槽内で、前記複数の気泡管部が収容される前記複数の基板の下方に、前記配列方向と直交する水平方向に間隔をあけて配置された気泡形成部と、
- 前記第1吐出部のそれぞれ及び前記第2吐出部のそれぞれに対応して設けられ、対応する前記第1吐出部または前記第2吐出部に対する不活性ガスの流量を独立して調整する複数の流量調整部と
- を備えることを特徴とする基板処理装置。
- [請求項2] 前記第1吐出部及び前記第2吐出部の前記複数のガス吐出孔は、下方内向きに不活性ガスを吐出することを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。
- [請求項3] 処理液を貯留するとともに、複数の基板を起立した状態で所定のピッチで配列させて収容する処理槽と、
- 前記処理槽内で、収容される前記複数の基板の下方に配置され、前記処理液を下方内向き及び下方外向きに吐出する複数の液吐出孔が前記複数の基板の配列方向に形成された液供給管と、
- 前記処理槽内で、収容される前記複数の基板の下方に配置され、不活性ガスを斜め下方に吐出して前記不活性ガスの気泡を前記処理液中に形成する複数のガス吐出孔が前記配列方向に形成された気泡管部と
- を備えることを特徴とする基板処理装置。
- [請求項4] 前記気泡管部は、前記液供給管に対して外側に近接して配置され、

前記不活性ガスを下方内向きに吐出することを特徴とする請求項 3 に記載の基板処理装置。

[請求項5] 前記複数のガス吐出孔は、前記複数の液吐出孔よりも低い位置に配されていることを特徴とする請求項 4 に記載の基板処理装置。